

美國網紅控訴前員工竊取其成功經營社群媒體之機密計算公式

美國J. Cathell公司於2022年12月21日以《保護營業秘密法》(Defend Trade Secrets Act of 2016)、《喬治亞州營業秘密法》(The Georgia Trade Secrets Act)控訴前員工Martin侵害其營業秘密「設計社群媒體發文及服裝策畫計算公式」。

J. Cathell公司是知名引領潮流、設計與旅遊的網紅兼部落客Jess Cathell所成立，其個別社群媒體皆有上千、萬名之追蹤者。其所經營之J. Cathell公司透過Instagram (@j.cathell)與網站(www.jcathell.com)提供前往特定目的地旅遊而設計的服裝，亦融合特定風格與特殊活動，同時提供販售連結。另有經營Facebook(J. Cathell Facebook)、Pinterest(J. Cathell Pinterest)、Like To Know It(下簡稱LTK)(J. Cathell LTK)等社群媒體。該服裝與風格設計是由Jess Cathell針對其客群研析出專屬、非公開之計算公式(營業秘密)所得出之結果。

被告Martin自2020年9月起任職於J. Cathell公司、擔任Jess Cathell的助理。Jess Cathell主張其提供Martin專屬計算公式之使用權限，並投注大量成本教導如何運用計算公式詮釋服裝策畫結果、設計社群媒體發文內容。前述資訊對J. Cathell公司皆具有獨立之實際或潛在經濟價值、他人亦可因被揭露之資訊，或使用該資訊而獲利。

Jess Cathell主張僅有自己、Martin能接觸專屬計算公式，並運用該公式產出設計社群媒體發文及服裝策畫結果。Jess Cathell為了保密，不曾以紙本記錄留存專屬計算公式相關資訊；用於追蹤銷售與其他績效指標的系統，皆以帳號、密碼保護。而Martin知悉該密碼，且於Martin任職期間多有提醒前述資訊之秘密性，Martin針對這些資訊具有保密義務。

Jess Cathell於2022年4月左右，發現WEAR TO WANDER公司(下簡稱WTW公司)成立Instagram、Pinterest、Facebook、LTK等帳號與WTW公司網站，於前述社群媒體發文的格式及概念，與J. Cathell公司於社群媒體發布的內容幾乎相同，並於同年8月發現Martin是WTW公司的創立者。Jess Cathell主張因Martin、WTW公司不當使用其營業秘密「設計社群媒體發文及服裝策畫計算公式」，在短短11個月內，WTW公司的Instagram即獲得近9萬名追蹤者，造成J. Cathell公司之財務與競爭損害，遂於同年12月向法院提出營業秘密侵害訴訟。

本案為首件社群媒體經營產業相關之營業秘密訴訟案件，後續判定將值得關注。

本文同步刊登於TIPS網站 (<https://www.tips.org.tw>)

相關連結

[Influencer Sues Former Employee for Stealing Secret Formula for Online Success, LEXOLOGY, Dec. 29, 2022](#)

你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創營業秘密與資安保障策略-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創營業秘密與資安保障策略-實體場
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-全盤掌握資金、控制權、稅務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-併購的教戰守則
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-專利申請與授權實務
- 創新生物製造產業法遵議題工作坊-核心技術保護與營業秘密管理
- 法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享
- 「跨域數位協作與管理」講座活動
- 新創必知的商標保護與申請
- 品牌企業商標管理實務課程
- 【北部場】營業秘密保護實務座談會



呂佳芸
專案經理 編譯整理

上稿時間：2023年01月

資料來源：

Influencer Sues Former Employee for Stealing Secret Formula for Online Success, LEXOLOGY, Dec. 29, 2022, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=90f91a07-fb62-49a1-9dee-bfaa6018c660>. (last visited Jan. 11, 2023).

延伸閱讀：J. Cathell, Inc. v. Martin Et Al, No. 1:22-cv-05039-LMM(N.D. Ga. filed Dec. 21, 2022)

文章標籤

智財訴訟 文化創意 智財管理 營業秘密 技術保護

推薦文章